東京大学大学院総合文化研究科　学術専門職員（特定有期雇用教職員）　公募要項

1.	職名及び人数	学術専門職員　　1名
2.	契約期間	2027年4月1日　～　2028年3月31日
3.	更新の有無	更新する場合があり得る。更新する場合は、1年ごとに行う。 更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。 ただし、更新回数は３回、在職できる期間は2031年3月31日を限度とする。
4.	試用期間	採用された日から14日間
5.	就業場所	大学院総合文化研究科（東京都目黒区駒場4−6−1生産技術研究所T棟） 変更の範囲：原則同一部局内
6.	所属	大学院総合文化研究科広域科学専攻 ※業務の都合により変更することがある。
7.	業務内容	JSTムーンショット研究題目「極低温下で三次元集積可能な超高精度RF量子制御のための研究開発」に関する実験研究において、スパッタなどの金属成膜やワイヤーボンダーなど微細加工されたイオントラップの作製、また装置の維持管理などの研究補助業務を東京大学野口研究室においておこなう。 変更の範囲：配置換及び兼務を命じることがある。
8.	就業日・就業時間	週5日（月曜日～金曜日） 1日7時間45分（9：00～17:45　※12:00～13:00休憩） ※時間外労働を命じることがある。
9.	休日	土・日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
10.	休暇	年次有給休暇、特別休暇　等
11.	賃金等	年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額３０万円～５０万円程度（資格、能力、経験等に応じて決定する）、通勤手当（支給要件を満たした場合に支給、原則55,000円／月まで）、超過勤務手当
12.	加入保険	法令の定めにより文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入
13.	応募資格	以下の条件を満たす方。 1. クリーンルーム内での微細加工の実務経験を有すること（大学、研究機関、企業等での経験を含む）。 2. 真空装置や薬品等を安全かつ適切に取り扱い、実験室の安全管理に関する規則を遵守できること。 3. 研究者や学生と協力しながら、実験装置の運用や微細加工業務に主体的に取り組めること。 **以下の経験・知識を有する方が望ましい。** • スパッタリング等の薄膜成膜技術 • リソグラフィ、ドライ・ウェットエッチング等の微細加工技術 • 真空装置や微細加工装置の維持管理・保守 • 微細加工プロセスの開発・改善、加工条件の最適化
14.	提出書類	東京大学統一履歴書（以下のURLからダウンロードし作成すること。） https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
15.	提出方法	〈電子媒体での提出の場合〉 上記書類の電子ファイルを以下のURLにアップロードすること。 https://forms.gle/i3dMXVi8SqRQrSGJA ※応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。
16.	応募締切	2026年12月14日（月）必着　書類選考の上、合格者に対し面接を実施。

17.	問い合わせ先	〒153-8902　東京都目黒区駒場 3-8-1 大学院総合文化研究科先進科学研究機構　担当：野口篤史 TEL:03-5452-6118　　e-mail:u-atsushi@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
18.	募集者名称	国立大学法人東京大学
19.	受動喫煙防止措置の状況	原則敷地内禁煙（屋外に指定喫煙場所あり）
20.	その他	・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。 ・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。